PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-138553

(43) Date of publication of application: 16.05.2000

(51)Int.CI.

H03H 9/145 H03H 3/08 H03H 9/25 H03H 9/64

(21)Application number: 10-310240

(71) Applicant: KYOCERA CORP

(22)Date of filing:

30.10.1998

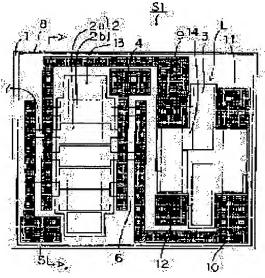
(72)Inventor: MATSUDA TOSHIYA

(54) SURFACE ACOUSTIC WAVE FILTER AND ITS MANUFACTURE

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain such a structure that a balanced surface acoustic wave filter which has a reliable electric power resistance and a smooth passing characteristic for its passing band can be manufactured in a small size and the influences of processes on its characteristics can be reduced.

SOLUTION: A surface acoustic wave filter S1 is constituted by connecting in parallel lattice type circuits L, in each of which surface acoustic wave resonators 3 each composed of a plurality of IDT electrode are connected to each other in a symmetric lattice, or ladder type circuits, in each of which the surface acoustic wave resonators 3 are connected in a ladder, on the input or output sides of IIDT electrodes 2 constituted by alternately juxtaposing plural IDT electrodes 2a for input and plural IDT electrodes 2b for output through wiring patterns. The IIDT electrodes 2 and extended electrode extensions 6 and 7 of the lattice circuits L are arranged on wiring patterns 4, 5, 9, 10, 11, and 12 and an insulating layer 8 disposed on the patterns.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開 2 0 0 0 - 1 3 8 5 5 3 (P 2 0 0 0 - 1 3 8 5 5 3 A) (43)公開日 平成12年5月16日(2000, 5, 16)

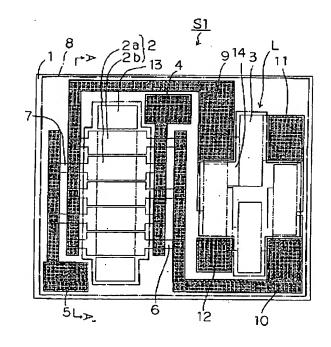
(51) Int. C1. 7		識別詞	记号		FΙ			テーマコード(参考)
H 0 3 H	9/145				нозн	9/145	D	5J097
							Α	
							С	
	3/08					3/08		
	9/25					9/25	Α	
	審査請求	未請求	請求項の数3	OL			(全7頁)	最終頁に続く
(21)出願番号	特願平10-310240				(71)出願人	0000066	33	
					(, -)	京セラ株式会社		
(22) 出願日	平成10年10月30日(1998.10.30)			,				竹田鳥羽殿町6番地
					(72)発明者	松田 铋	战	
						京都府相	楽郡精華町	光台3丁目5番地 京セ
						ラ株式会社中央研究所内		
					Fターム(参	考) 5J09	97 AA26 AA28	BB01 BB11 DD25
							DD29 EE08	FF01 GG01 GG03
		•					GG04 GG05	HA02 HA07 KK04
							KK09	

(54) 【発明の名称】弾性表面波フィルタ及びその製造方法

(57) 【要約】

【課題】 耐電力に対して信頼性があり、通過帯域の平滑な通過特性である平衡型弾性表面波フィルタを小型に 作製でき、プロセスによる特性への影響を小さくする構造が得られるようにすること。

【解決手段】 複数の入力用IDT電極2aと複数の出力用IDT電極2bとを交互に並設したIIDT電極2の入力又は出力側に、複数のIDT電極から成る弾性表面波共振子3どうしを対称格子状に接続したラティス型回路L、又は複数のIDT電極から成る弾性表面波共振子を梯子状に接続したラダー型回路を配線パターンを介して接続して成るSAWフィルタS1とし、IIDT電極2とラティス型回路Lの電極延在部6,7が、配線パターン4,5,9,10,11,12上、及びこれらの配線パターン上に設けた絶縁層8上に配設する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 複数の入力用IDT電極と複数の出力用 IDT電極とを交互に並設したIIDT電極の入力又は 出力側に、複数のIDT電極から成る弾性表面波共振子 どうしを対称格子状に接続したラティス型回路、又は複 数のIDT電極から成る弾性表面波共振子を梯子状に接 続したラダー型回路を配線パターンを介して接続して成 り、前記IIDT電極と前記ラティス型回路又はラダー 型回路の電極延在部が、前記配線パターン上、及び該配 線パターン上に設けた絶縁層上に配設されていることを 10 特徴とする弾性表面波フィルタ。

【請求項2】 前記IIDT電極と前記ラティス型回路 又はラダー型回路上に下記式を満足する保護層が積層さ れてなることを特徴とする請求項1に記載の弾性表面波 フィルタ。

 $1 \times 10^9 \Omega \leq \rho / h \leq 1 \times 10^{13} \Omega$

(ただし、ρ:保護層の比抵抗値、h:膜厚)

【請求項3】 複数の入力用 I D T 電極と複数の出力用 IDT電極とを交互に並設したIIDT電極の入力又は 出力側に、複数のIDT電極から成る弾性表面波共振子 どうしを対称格子状に接続したラティス型回路、又は複 数のIDT電極から成る弾性表面波共振子を梯子状に接 続したラダー型回路を接続して成る弾性表面波フィルタ の製造方法であって、前記IIDT電極と前記ラティス 型回路又はラダー型回路とを接続する配線パターンを形 成する工程、少なくとも前記IIDT電極と前記ラティ ス型回路又はラダー型回路との接続部を除く領域に絶縁 層を形成する工程、及び前記IIDT電極と前記ラティ ス型回路又はラダー型回路とを形成する工程を順次行う ようにしたことを特徴とする弾性表面波フィルダの製造 30 方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、例えば自動車電話 及び携帯電話等の移動体無線機器に内蔵される周波数帯 域フィルタに関し、特に不平衡平衡変換型の弾性表面波 フィルタに関する。

[0002]

【従来の技術】従来の弾性表面波(Surface Acoustic W ave :以下、SAW と略す)装置の基本構成は、圧電基板 40 上に一対の櫛歯状電極(Inter Digital Transducerで、 以下、IDT 電極と略す)を1つ以上配設され、このIDT 電極から励起されるのSAW の伝搬路上に、SAW を効率良 く共振させるための反射器がその両端に配設される。

【0003】IDT 電極及び反射器は、例えば36°Y カッ トX 伝搬タンタル酸リチウム単結晶等からなる圧電基板 上に、蒸着法,スパッタ法等の薄膜形成法により、A1や Al-Cu 合金等の導電物がフォトリソグラフィ法で微細な 電極パターンに形成され作製される。

【0004】また、この移動体通信機器等の小型・軽量 50 路Lの入力電極、61,62は平衡出力対の電極であ

化及び低コスト化のための使用部品点数削減により、SA W フィルタに新たな機能の付加が要求されている。その 一つに、受送信号周波数のダウンコンバート及びアップ コンバートを行なうミキサICの平衡入出力端に、不平衡 入力ー平衡出力又は平衡入力ー不平衡出力の電気接続が 可能なSAW フィルタ(以下、平衡型SAW フィルタとい う)が望まれている。また、ミキサICにより平衡端で終 端される公称抵抗値は変化するため、この抵抗値に合わ せて平衡型SAW フィルタの平衡端接続抵抗を設計する必 要がある。

【0005】従来のSAW フィルタは、一般に不平衡入力 -不平衡出力しかできない接続構造であるため (例え ば、特開平5-183380号公報等を参照)、SAW フ ィルタとミキサICの間にバランと呼ばれる平衡-不平衡 変換器を介して接続する。

【0006】また、平衡型SAW フィルタとして、例えば 図11に示すように、帯域外減衰量を向上させるため、 鏡面対称に2つの共振子型フィルタ71, 72を接続し た弾性表面波フィルタ J 0 が知られている (特開平8-65094号公報等を参照)。このような共振器型フィ ルタにおいては平衡入出力に対応できるものの、SAWの エネルギーが共振器型フィルタの中に蓄積させ、特にRF ブロックの帯域フィルタを形成するように構成するた め、IDT 電極の櫛歯のピッチを非常に小さくししなけれ ばならないが、これにより、RFブロックに電力を印加し た場合、電極のマイグレーションでフィルタ特性が劣化 することがあり、信頼性上大きな問題となる。

【0007】これらの問題点を解決するため、まずSAW フィルタに印加される電力を分散させるべく、多数の共 振子を用いて構成させた複合共振子型SAW フィルタ構造 と、平衡型SAW フィルタとして、IDT 電極を入出力1つ 置きに載置したマルチ電極(Inter-degitated Inter Di gital Transducerで、以下、IIDT電極と略す)を複合さ せて構成し、電圧を分散させ耐電力性を向上させる必要 がある。

【0008】また、IIDT電極はIDT 電極の構成が多数で あるため、従来から行われていたAlワイヤやAuワイヤに よる配線が複雑であり、このワイヤとIIDT電極を接続さ せるパッド部も多大な面積が必要となる。

【0009】そこで本出願人は、図6に示すように、圧 電基板51上に複数の入力用IDT 電極52aと複数の出 カ用IDT 電極52bとを交互に並設したIIDT電極52の 入力又は出力側に、複数のIDT 電極から成る弾性表面波 共振子53どうしを対称格子状に接続したラティス型回 路L又は複数のIDT 電極から成る弾性表面波共振子を梯 子状に接続したラダー型回路を接続して成る弾性表面波 フィルタ J を提案している。なお、54は入力電極、5 5は接地電極、56は入力側立体配線部、57は出力側 立体配線部、58は絶縁層、59,60はラティス型回

3

る。

[0010]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記のようなフィルタを立体配線接続する場合、まず図7に示すようにIIDT52及び弾性表面波共振子53を圧電基板51上に形成し、次に、その上に図8に示す絶縁層58を形成し、最後に、図9に示す入力電極54、接地電極55、格子型電極の入力電極59,60、平衡出力対の一方の電極61、平衡出力対のもう一方の電極62を形成する構造であるので、絶縁層58が適度に厚くなり、どに各弾性表面波共振子上の絶縁層58が厚すぎると、フィルター特性が劣化してしまうという問題があった。

【0011】また、上記構造の場合、櫛歯電極の形成後に絶縁層58で保護してから配線等を形成すると、櫛歯電極上の絶縁層58に一度電極材料の成膜とエッチングの工程がなされるため、どうしても絶縁層58の表面がエッチングされ、周波数が変化するなどの問題が生ずる。

[0012]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため、本発明の弾性表面波フィルタは、複数の入力用ID T電極と複数の出力用IDT電極とを交互に並設したIIDT電極の入力又は出力側に、複数のIDT電極から成る弾性表面波共振子どうしを対称格子状に接続したラティス型回路、又は複数のIDT電極から成る弾性表面波共振子を梯子状に接続したラダー型回路を配線パターンを介して接続して成り、IIDT電極と前記ラティス型回路又はラダー型回路の電極延在部が、配線パターン 30上、及び該配線パターン上に設けた絶縁層上に配設されていることを特徴とする。

【0013】また、IIDT電極とラティス型回路又は ラダー型回路上に下記式を満足する保護層が積層されて なることを特徴とする。

【0014】 1×10^{9} $\Omega \le \rho / h \le 1 \times 10^{13}$ Ω (ただし、 ρ : 保護層の比抵抗値、h: 膜厚)

また、本発明の弾性表面波フィルタの製造方法は、複数の入力用IDT電極と複数の出力用IDT電極とを交互に並設したIIDT電極の入力又は出力側に、複数のIDT電極から成る弾性表面波共振子どうしを対称格子状に接続したラティス型回路、又は複数のIDT電極から成る弾性表面波共振子を梯子状に接続したラダー型回路を接続して成る製造方法であって、IIDT電極とラティス型回路又はラダー型回路とを接続する配線パターンを形成する工程、少なくともIIDT電極とラティス型回路又はラダー型回路との接続部を除く領域に絶縁層を形成する工程、及びIIDT電極とラティス型回路又はラダー型回路とを形成する工程を順次行うようにしたことを特徴とする。

[0015]

【発明の実施の形態】本発明に係るSAW フィルタの実施 形態を図面に基づき詳細に説明する。

4

【0016】図1に示すように、本発明のSAW フィルタ S1は、複数の入力用IDT電極2aと複数の出力用IDT電極2bとを交互に並設したIIDT電極2の入力 又は出力側に、複数のIDT電極から成る弾性表面波共 振子3どうしを対称格子状に接続したラティス型回路 L、又は複数のIDT電極から成る弾性表面波共振子を 梯子状に接続したラダー型回路を配線パターンを介して接続して成るものである。また、図5に示すように、IIDT電極2とラティス型回路L又はラダー型回路の電極延在部6,7が、配線パターン4,5,9,10,11,12上、及びこれらの配線パターン上に設けた絶縁 層8上に配設されている。

【0017】また、図5に示すように、IIDT電極と ラティス型回路L又はラダー型回路上に保護層15が積 層されていてもよい。

【0018】ここで、圧電基板1は、36°±3°YカットX伝搬タンタル酸リチウム単結晶、42°±3°YカットX伝搬タンタル酸リチウム単結晶、64°±3°YカットX伝搬ニオブ酸リチウム単結晶、41°±3°YカットX伝搬ニオブ酸リチウム単結晶、45°±3°XカットZ伝搬四ホウ酸リチウム単結晶等が好適に使用でき、これらの圧電基板は電気機械結合係数が大きく且つ周波数温度係数が小さいため好ましい。この圧電基板1の厚みは0.1~0.5mm程度が良く、0.1mm未満では圧電基板が脆くなり、0.5mm超では材料コストと部品寸法が大きくなり使用できない。

【0019】また、IDT 電極2及び反射器13は、Al若しくはAl合金(Al-Cu 系、Al-Ti 系等)から成り、蒸着法、スパッタリング法、またはCVD 法等の薄膜形成法により形成する。そして、IDT 電極2は、対数 $30\sim20$ の対程度、IDT 電極ピッチは $0.4\mu m\sim20\mu m$ 程度、交差幅(開口幅)は $10\mu m\sim500\mu m$ 程度、IDT 電極厚みは $0.1\mu m\sim0.5\mu m$ 程度とすることがSAW フィルタとしての特性を得る上で好適である。

【0020】4は入力電極用配線パターン、5は接地電極用配線パターン、6は入力側立体接続配線部、7は接地側立体接続配線部である。このような構成により、入力電極用配線パターン4及び接地電極用配線パターン5にRF電気信号を加え、立体配線された構造を持つIIDT電極2に電気信号が加えられる。

【0021】また、絶縁層8はSi02, SiN, 又はAl203 等の1種以上から成る絶縁薄膜とする。

【0022】また、本特許に係るSAW フィルタ素子の電極及び圧電基板上のS AW伝搬部にSi、 $Si0_2$ 、SiN、 Al_20_3 を保護層15として形成し、導電性異物による通電防止や耐電力向上を行うとよい。ここで、保護層15の膜厚は15nm~75nmが好ましい。15nmよ

り薄いと保護層としての機能をはたさなく、75nmよ り厚いとフィルターの挿入損失が大きくなるという問題 が生じる。

【0023】また、この時の保護層の比抵抗値を ρ 、膜 厚をhとしたとき ρ /hが1×10°~1×10¹³Ωで あると、焦電性による電極間の放電を防止することがで きる。

【0024】また、上記弾性表面波フィルタS1は、少 なくとも以下の工程により製造される。まず、図2に示 すように、IIDT電極2とラティス型回路L又はラダ 10 一型回路とを接続する配線パターン4,5,9,10, 11, 12を形成する工程を行う。次に、少なくとも I IDT電極2とラティス型回路L又はラダー型回路との 接続部を除く領域に絶縁層8を図3に示すようなパター ンに形成する工程を行う。そして、図4に示すように、 IIDT電極2とラティス型回路L又はラダー型回路と を形成する工程を行うようにしている。

【0025】かくして得られた弾性表面波フィルタS1 によれば、図10に示すように、少なくとも中心周波数 数(周波数を中心周波数で割った値)での減衰量から、 帯域内偏差の小さな非常に良好な特性が得られた。

[0026]

【実施例】図1に示したように、入力側にIIDT電極型を 出力側に格子接続の共振子を配置させ、これらの配線は 図1の6、7の構造によりワイヤによる配線を簡便化し た設計を行った。IIDT電極の電極線幅は1. $1 \mu m$ であ り、格子型に構成された直列腕共振子のIDT電極の線 幅は1.05μmであり、また格子腕共振子のIDT電 極の線幅は1. 1μ mとした。また、電極膜厚は320 OAであり、全櫛歯状電極ピッチの平均値λと櫛歯状電 極の電極膜厚hとの比は7.4%とした。

【0027】具体的な作製方法を、以下に説明する。

【0028】42°Y カットX 伝搬タンタル酸リチウム単 結晶から成る圧電基板上に、前記構造、前記共振子電極 詳細を網羅する回路パターンを形成することにより作製 した。まず洗浄した基板にレジストを約 1μ mの膜厚で 塗布し、 N₂ 雰囲気中でベークを行った。

【0029】次に、紫外線(Deep-UV) を用いた密着露光 機によるフォトリソグラフィー法により基板上に多数の 40 SAW フィルタのレジストのネガパターンを形成した。こ の時、フォトマスクは厚み0.25インチのものを使用し た。

【0030】次に、ネガパターン上に電子ビーム蒸着機 でAlを成膜した。その後、レジスト剥離液中で不要なAl をリフトオフし、図2に示す概略形状のA1電極パターン を作製した。次に、スパッタリング法 SiO2 を成膜し た。

【0031】その後、レジストを約1μmの膜厚で塗布 し、 № 雰囲気中でベークを行った。次に、紫外線(Dee 50

p-UV) を用いた密着露光機によるフォトリソグラフィー 法により基板上に図3のパターンにレジストを形成し た。CF4 と O2 を主成分とするガスでR I Eをおこな い、SiO₂ をパターニングした。

【0032】次に、電子ビーム蒸着機でAlを成膜した。 再度上記と同様のフォトリソグラフィー技術を用い、多 数のSAW フィルタのレジストのパターンを形成した。Al のエッチングは BCl3 とCl2 と N2 ガスを用いてRIE 法 により行った。その後、レジスト剥離液中で不要なAlを リフトオフし、IDT 電極等の微細な回路パターンを作製 した。その後、IDT 電極をネットワークアナライザに接 続し、挿入損失の周波数特性を測定した。

【0033】その結果、中心周波数800MHz~2. 5GHzの範囲において帯域内偏差は1.2dBであ り、良好な特性を得られた。

[0034]

【発明の効果】以上説明したように、本発明の弾性表面 波フィルタ及びその製造方法によれば、配線パターンの 形成後に絶縁層と電極層にて立体配線されるようにした 800MHz~2.5GHzの範囲における規格化周波 20 ので、絶縁層を十分に厚くすることができ、電極間容量 を小さくできる。また層間絶縁層として十分な機能を持 たせることができ、優れた弾性表面波フィルタを提供す ることができる。

> 【0035】また、絶縁層が微細なIDT電極のエッチ ング工程にさらされることがなく、周波数変化などの特 性変化のない信頼性の優れた弾性表面波フィルタを提供 することができる。

【0036】さらに、弾性表面波共振子上に厚い絶縁層 を設ける必要がなく、これによる特性の劣化の心配がな い上、弾性表面波共振子上に最適な保護層を形成するこ とにより、信頼性や特性の優れた弾性表面波フィルタを 提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る弾性表面波フィルタを模式的に示 す概略平面図である。

【図2】本発明に係る弾性表面波フィルタの圧電基板上 第1層めの平面図である。

【図3】本発明に係る弾性表面波フィルタの圧電基板上 第2層めの平面図である。

【図4】本発明に係る弾性表面波フィルタの圧電基板上 第3層めの平面図である。

【図5】図1におけるA-A'線断面図である。

【図6】弾性表面波フィルタを模式的に示す概略平面図

【図7】図5に示す弾性表面波フィルタの圧電基板上第 1層めの平面図である。

【図8】図5に示す弾性表面波フィルタの圧電基板上第 2層めの平面図である。

【図9】図5に示す弾性表面波フィルタの圧電基板上第 3層めの平面図である。

8

【図10】本発明の弾性表面波フィルタの特性図であ ス

【図11】従来の共振器型フィルタの構造を示す平面図である。

【符号の説明】

1:圧電基板 2:IIDT電極

3:格子型電極

4:入力電極

8:絶縁層

5:接地電極

6:入力側立体配線部

7:接地側立体配線部

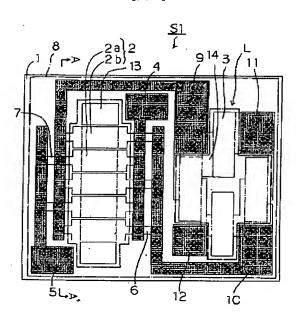
9,10:ラティス型回路の入力電極

11:平衡出力対の一方の電極 12:平衡出力対の他方の電極

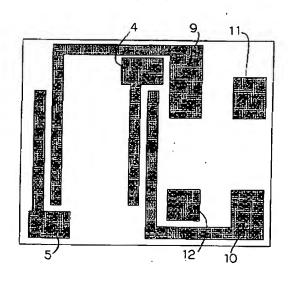
15:保護層

S1:弾性表面波フィルタ

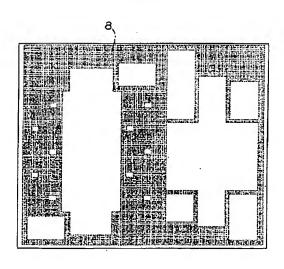
【図1】



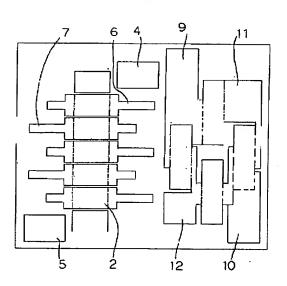
【図2】



[図3]



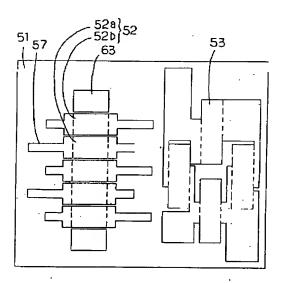
·【図4】



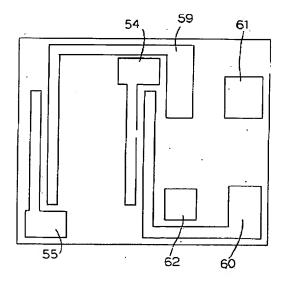
【図5】



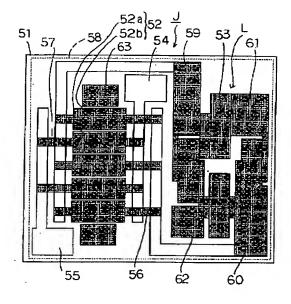
【図7】



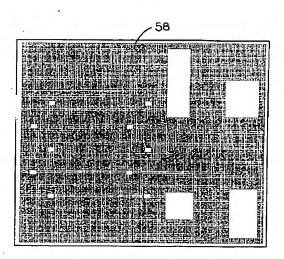
【図9】



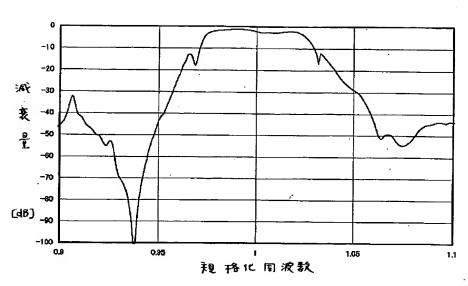
【図6】



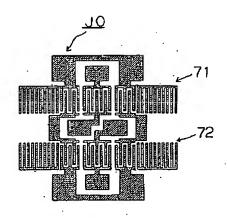
【図8】







【図11】



フロントページの続き

(51) Int. Cl. 7

識別記号

FΙ

テーマコード(参考)

HO3H 9/64

H 0 3 H 9/64

Z